# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## PREPARATION OF DIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINE

Patent Number:

JP60048951

Publication date:

1985-03-16

Inventor(s):

TASHIRO SHIGERU; others: 01

Applicant(s):

ASAHI KASEI KOGYO KK

Requested Patent:

F JP60048951

Application Number: JP19830156275 19830829

Priority Number(s):

IPC Classification:

C07C87/14; B01J25/00; C07C85/12

**EC Classification:** 

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE:To obtain the titled compound useful as a raw material for agricultural chemicals, drugs, and transparent nylon in high yield in high selectivity, by hydrogenating dimethyladiponitrile in a lower alkyl alcohol solvent by the use of a Raney catalyst and a basic cocatalyst.

CONSTITUTION: In >=10wt% solution of a Raney nickel catalyst obtained by developing a Raney nickel alloy in an aqueous solution of NaOH in a lower alcohol such as preferably ethyl alcohol,

dimethyladiponitrile is hydrogenated in the presence of a basic cocatalyst of an alkali metal hydroxide such as NaOH, etc. at 50-160 deg.C at >=10kg/cm<2>G H2 partial pressure for >=1hr, the catalyst is separated from the reaction solution by a filter, and purified by distillation, etc., to give high-purity dimethylhexamethylenediamine.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

## ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

昭60-48951

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)3月16日

C 07 C 87/14 25/00 01 C 07 C

85/12

7118-4H

7059—4G

7118-4H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

ジメチルヘキサメチレンジアミンの製造法

创特 願 昭58-156275

願 昭58(1983)8月29日

70発 明 者

茂

延岡市旭町 6 丁目4100番地 旭化成工業株式会社内

の発 明 者 滑 水

俊 雄

延岡市旭町6丁目4100番地 旭化成工業株式会社内

の出 頣 旭化成工業株式会社

図出

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

#### 睭

#### 1.発明の名称

**ジメチルヘキサメチレンジアミンの製造法** 

### 2. 特許請求の範囲

**ジメチルアジポニトリルを低級アルキルアルコ** ール溶媒中で、ラネー触媒及び塩基性助触媒を用 いて水素添加することを特徴とするジメチルヘキ サメチレンジアミンの製造法

## 3.発明の静細な説明

本発明は、クメチルアジポニトリル(以下 DMADNと略す)を水素添加し、高収率、高選択率 でジメチルヘキサメチレンジアミン(以下 DMHMD と略すりを製造する方法に関するものである。

DMHMD は、農薬、医薬の原料として有用である ほか、透明ナイロンの原料として重要な物質であ る。

DMADN から DMHMD を製造する従来技術としては、 DMADN をラネーニッケルの存在下で水素添加して 製造する方法 [ Tetrahedren letter, 1970 P - 3 7 9 1 ~ 4 ] が提案されているが、この数

法は詳細な説明がなく単にラネーニッケルを用い 水素添加を行うと記載されているだけであり鮮細 な製法は分らないが、反応収率は DMHMD で5 6 %、 シメチルヘキサメチレンイミン(以下 DMHMI と略 すりで98と記載されており、反応収率からでは 工業的な製造法としては十分なものとはいいがた

本発明者らは、 DMHMD の収率が高収率で且つエ 業的に容易に実施しうる方法を開発すべく鋭金研 究を重ねた結果、低級アルキルアルコール溶鉄中 で、ラネー触媒及び助触媒を用いて水象添加する ことで、極めで高収率で容易に DMHDMD を製造しう ることを見出した。

本発明は、 DMHMD の収率が高収率で、且つ工業 的に有利な DMHMD の製造する方法を提供すること を目的とするものである。

上記目的を選成した本発明の DMHMD を製造する 方法は、ジメチルアジポニトリルを低級アルキル アルコール溶媒中で、ラネー触媒及び塩基性助触 棋を用いて水業添加することを特徴とするもので 'ある。'

以下、本発明を詳しく説明する。

本発明の水素額加反応は低級アルキルアルコールの溶媒中で行なり必要がある。低級アルキルアルコールとしてはメチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコールは収率が低下するため、エチルアルコールを用いることが好ましい。

低級アルキルアルコールの機度としては、10 多以上あればよく、10多以下では DMHMD の収率 が低下する。又、上限機度としては、反応器の容 積効率、精製工程での用役コスト等の経済性から 決められる。

本発明において、触媒はタネー触媒を用いることが必要である。タネー触媒としては、タネーニックル触媒、タネーコパルト触媒であり、経済性の点からタネーニッケル触媒を用いることが好ましい。

触媒量としては、仕込み DMADN に対して重量比

-3-

カによつて決まるが、通常1時間以上あればよい。 反応液の撹拌としては、触媒が反応液中に均一 に分散する撹拌であればよい。

反応方法としては、原料を一度に仕込み DMADN を消費するまで反応を行う回分式か、原料を連続 で仕込み、生成物を連続で抜き出す連続方式等が ある。

反応核の精製方法としては、常法によつて行うことができる。例えば、反応核からフィルター等で触媒を分離した後、蒸留で精製し、高純度のDMHMDを得る方法である。

以上詳述した如く、本発明の適用により 1) 高 収率で DMHMD を得ることができる。 2) 剛生成物 がほとんど生成されないので、 DMHMD の精製が極 めて容易に行うことができる。などの効果がらた らされる。

以下、本発明を突縮例により更に詳細に説明する。

夹施例1

- 圧力計、安全弁、ガス抜き弁、ガス供給弁、及

で 0.0 0 2 以上用いればよく、 0.0 0 2 以下では 反応が進まない。 触鉄量の上限としては制限がな いが、 触鉄コスト、 及び提拌上からおのずと制限 される。

本発明においては、塩基性助触媒を用いる必要がある。塩基性助触媒としては、アルカリ金属の水酸化物であり、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等である。このうち経済性の点から水酸化ナトリウムを用いることが好ましい。

塩基性助触媒の使用量としては、反応液中の濃度として 0.1 重量を以上あればよい。 0.1 重量を以下の場合は反応が進行しない。

・反応温度としては、50℃~160℃の範囲で行うことが好ましい。50℃以下では反応は進まず、160℃以上では反応収率が低下する。

反応圧力としては、 は控密媒の分圧と水素分圧とからなるが、 水素分圧としては触媒 登及び反応 温度にもよるが、 通常 1 0 kg/cm² G 以上 あればよい。 1 0 kg/cm² G 以下の場合反応が十分過まない。 反応時間としては、 触鉄量、 反応温度、 反応圧

-4-

び攪拌扱付ステンレス製の内容積100cc のオ ートクレープ(以下単にオートクレープと略す) に、市販のラネーニッケル合金( Ni : Al : Fe 重量比=50:49.5:0.5)をNaOH 水溶液で 展開した後水洗して得られたラネーニッケル触媒 0.5 8をエチルアルコールで水を監換したものと DMADN 2 0 g、3 0 あ-NaOH 水溶液 0.3 g、エチ ルアルコール30gを仕込んだ袋、オートクレー プ内の空気を敷初盥案、次いで水楽で置換し水袋 を20Kp/cm²c まで導入した。(尚、水泉ガスは 150㎏/a゚0に充填されたポンペより、定圧弁 を経由して反応圧力が一定になる様供給される。) 次にヒーターで加熱して昇温し、同時に撹拌扱に . よつてオートクレープ内を回転数1000R PM で撹拌した。昇温開始後15分で設定温度85℃ に到達したので反応開始とした。反応中は蟲皮、 圧力を保持する様に調整しながら水素添加を行え つた。反応開始後、90分経過した時点で水素の 供給を停止し、オートクレープを冷却し反応を停 止した。反応終了後、反応被の重量測定、ガスク

特周昭60-48951(3)

実施例 1 の 3 0 ま - Na OH 水溶液 0.3 g か 5 3 0 ま - KOH 水溶液 0.3 g へ、 反応温度 8 5 ℃から 1 2 0 ℃へ変更する以外は実施例 1 と同様にして 水磁反応を行つたところ、反応成績は、 DMADN の 転化率で 1 0 0 ま、 DMHMD の 3 択率で 9 9.1 ま、 DMHMI の 3 択率で 0.5 まであった。

特許出顧人 旭化成工架株式会社

DMADN の転化率で100多、 DMHMD の選択率で 99.8 多であつた。 剛生成物としては、 ガスクロマトグラフでは検出されなかつた。

## 夹始例 2

実施例1のエチルアルコールからメチルアルコールに変更する以外は全て実施例1と同一条件で水低反応を行つたところ、反応成績は、 DMADN の転化率で100%、 DMHMD の選択率で92.8%、 副生成物である DMHMI の選択率は5.4%であつた。 実施例3

実施例1のタネーニンケル触媒の代わりに、市販のタネーコパルト合金(A1: Co 重量比=50:50)を NaOH 水溶液で展開した後水洗して得られたタネーコパルト触媒 0.5gをエチルアルコールで水を関撲したものを用いる以外は実施例1と同様にして水磁反応を行つたところ、反応成機は DMADNの転化率で100%、 DMHMDの選択率で98.2%、 DMHMIの選択率で1.4%であつた。実施例4

-7-